Wyznaczanie charakterystyki prądowo-napięciowej diody rezonansowo-tunelowej (RTD) oraz zastosowanie przybliżenia adiabatycznego do wyznaczenia zjawiska kwantyzacji konduktancji w kwantowym kontakcie punktowym (QPC).

P. Wójcik

10 czerwca 2021; ostatnia aktualizacja 13 kwietnia 2023

1 Wstęp

Zadanie skład się z dwóch części i dotyczy symulacji transportu elektronowego przez dwa nanourządzenia:

- diodę rezonansowo-tunelowa,
- kwantowy kontakt punktowy w nanodrucie 2D, w przybliżeniu adiabatycznym.

Obie metody oparte są na obliczeniach współczynnika transmisji, który określa prawdopodobieństwo tego, że elektron wstrzyknięty do lewego kontaktu opuści nanourządzenie przez prawy kontakt. Obliczenia współczynnika transmisji wykonane zostaną w oparciu o metodę macierzy transferu w 1D.

2 Metoda macierzy transferu

Rozważmy równanie Schrödingera 1D dla układu otwartego, z masą elektronu zależną od położenia

$$-\frac{\hbar^2}{2}\frac{d}{dz}\frac{1}{m^*(z)}\frac{d}{dz}\psi(z) + U(z)\psi(z) = E\psi(z), \tag{1}$$

gdzie $m^*(z)$ określa masę efektywną w położeniu z, zaś U(z) to profil energii potencjalnej. Obszar nanourządzenia [0,L], w którym zdefiniowany jest potencjał podzielmy na N części, tak małych, aby w każdym przedziale $[z_{n-1},z_n]$ potencjał U(z) i masę elektronu $m^*(z)$ można było traktować jako stałe. Równanie Schrödingera dla obszaru $[z_{n-1},z_n]$ przyjmuje postać

$$-\frac{\hbar^2}{2m^*}\frac{d^2}{dz^2}\psi_n(z) + U_n\psi_n(z) = E\psi_n(z),$$
(2)

a jego rozwiązaniem w tym obszarze jest funkcja falowa w postaci

$$\psi_n(z) = A_n e^{ik_n z} + B_n e^{-ik_n z},\tag{3}$$

gdzie

$$k_n = \frac{1}{\hbar} \sqrt{2m_n^*(E - U_n)},\tag{4}$$

natomiast A_n i B_n są amplitudami fal płaskich biegnących odpowiednio w prawo i w lewo. Zauważmy jednak, że funkcja falowa na granicy każdego z obszarów musi być ciągła, a zatem

$$\psi_n(z_n) = \psi_{n+1}(z_n). \tag{5}$$

Ciągły musi być również strumień gęstości prawdopodobieństwa

$$j_n = j_z(z_n) = \frac{i\hbar}{2m_n} \left[\psi(z_n) \frac{d\psi^*(z)}{dz} \bigg|_{z=z_n} - \psi^*(z_n) \frac{d\psi(z)}{dz} \bigg|_{z=z_n} \right], \tag{6}$$

co prowadzi do warunku ciągłości

$$\frac{1}{m_n} \frac{d}{dz} \psi_n(z_n) = \frac{1}{m_{n+1}} \frac{d}{dz} \psi_{n+1}(z_n). \tag{7}$$

Stosując warunki ciągłości pomiędzy obszarami $\left[z_{n-1},z_{n}\right]$ oraz $\left[z_{n},z_{n+1}\right],$ otrzymujemy

$$\begin{pmatrix} A_n \\ B_n \end{pmatrix} = \mathcal{M}_n \begin{pmatrix} A_{n+1} \\ B_{n+1} \end{pmatrix}, \tag{8}$$

gdzie macierz \mathcal{M}_n nazywamy macierzą monodromii.

Macierz ta jest macierzą kwadratową, której poszczególne elementy to:

$$\mathcal{M}_{n,11} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{k_{n+1} m_n^*}{k_n m_{n+1}^*} \right) \exp\left(i(k_{n+1} - k_n) z_n \right),$$

$$\mathcal{M}_{n,12} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{k_{n+1} m_n^*}{k_n m_{n+1}^*} \right) \exp\left(-i(k_{n+1} + k_n) z_n \right),$$

$$\mathcal{M}_{n,21} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{k_{n+1} m_n^*}{k_n m_{n+1}^*} \right) \exp\left(i(k_{n+1} + k_n) z_n \right),$$

$$\mathcal{M}_{n,22} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{k_{n+1} m_n^*}{k_n m_{n+1}^*} \right) \exp\left(-i(k_{n+1} - k_n) z_n \right).$$
(9)

Stosując macierz monodromii kolejno pomiędzy wszystkimi obszarami otrzymujemy

$$\begin{pmatrix} A_1 \\ B_1 \end{pmatrix} = \mathcal{M}_{1 \to N} \begin{pmatrix} A_N \\ B_N \end{pmatrix}, \tag{10}$$

gdzie

$$\mathcal{M}_{1\to N} = \mathcal{M}_1 \mathcal{M}_2 \dots \mathcal{M}_{N-1}. \tag{11}$$

Zauważmy, że w najbardziej skrajnym lewym obszarze nie ma elektronów odbitych, a zatem B_N =0. Wówczas współczynniki odbicia i transmisji wyrażają się wzorami

$$T = \frac{k_N m_1}{k_1 m_N} \frac{|A_N|^2}{|A_1|^2},\tag{12}$$

$$R = \frac{|B_1|^2}{|A_1|^2},\tag{13}$$

(14)

Zakładając dodatkowo $A_N=1$ otrzymujemy

$$T = \frac{k_N m_1}{k_1 m_N} \frac{1}{|M_{1 \to N, 11}|^2},\tag{15}$$

$$T = \frac{k_N m_1}{k_1 m_N} \frac{1}{|M_{1 \to N, 11}|^2},$$

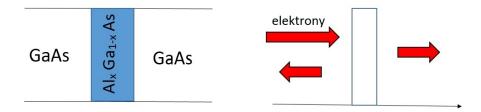
$$R = \frac{|M_{1 \to N, 21}|^2}{|M_{1 \to N, 11}|^2}.$$
(15)

(17)

Obliczenia przeprowadzamy zmieniając energię padającego elektronu i otrzymujemy dwie funkcje R(E) oraz T(E) takie, że T(E) + R(E) = 1.

2.1Zadania do wykonania

Rozpatrzmy urządzenie przedstawione na rysunku 1. Ponieważ przerwa energetyczna w GaAs rożni się od przerwy energetycznej w AlGaAs, potencjał jaki "widzi" elektron przepływający przez heterostrukturę ma kształt pojedynczej bariery potencjału przedstawionej na rysunku.



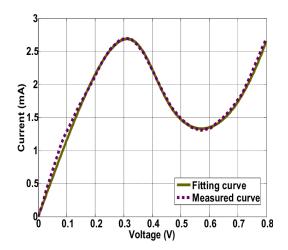
Rysunek 1: Schemat struktury tunelowej $GaAs/Al_{0.3}Ga_{0.7}As$ wraz z efektywnym potencjałem z jakim oddziałuje elektron przepływający przez nanourządzenie.

Załóżmy następujące parametry urządzenia: szerokość warstwy AlGaAs, $d_{AlGaAs}=5$ nm, masa efektywna w poszczególnych materiałach $m^*_{GaAs}=0.063m_0$ dla GaAs, oraz $m^*_{AlGaAs}=(0.063+0.083x)m_0$ dla Al $_x$ Ga $_{1-x}$ As. Obliczenia wykonaj dla x=0.3, dla którego wysokość bariery U=0.27 eV.

- 1. Dla rozpatrywanego urządzenia oblicz współczynniki transmisji oraz odbicia w funkcji energii, zakładając stałą masę efektywną w nanourządzeniu $m^* = m^*_{GaAs} = 0.063$. Wyniki metody numerycznej porównaj z wartościami współczynnika transmisji wyznaczonymi analitycznie.
- 2. Oblicz współczynnik transmisji oraz odbicia zakładając zmienną masę efektywną różną dla GaAs oraz AlGaAs.

3 Dioda rezonansowo-tunelowa

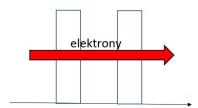
Dioda rezonansowo-tunelowa jest planarnym urządzeniem elektronicznym charakteryzującym się nielinowych zachowaniem prądowo-napięciowych, z charakterystycznym obszarem negatywnego oporu różnicowego - patrz rys. 2



Rysunek 2: Charakterystyka prądowo-napięciowa diody RTD z charakterystycznym obszarem ujemnego oporu różnicowego (NDR - z ang. negative differential resistance).

Typowa struktura RTD przedstawiona została na rys. 3. Zakładając strukturę półprzewodnikową jak na rysunku 3 możemy założyć, że profil potencjału w nanourządzeniu na kształt podwójnej bariery potencjału.





Rysunek 3: Schemat struktury RTD opartej na $GaAs/Al_{0.3}Ga_{0.7}As$ wraz z efektywnym potencjałem z jakim oddziałuje elektron przepływający przez nanourządzenie.

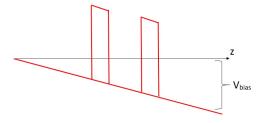
W obliczeniach założymy zmienną od położenia masę efektywną $m^*_{GaAs} = 0.063m_0$ dla GaAs, oraz $m^*_{AlGaAs} = (0.063+0.083x)m_0$ dla Al $_x$ Ga $_{1-x}$ As. Obliczenia wykonamy dla x=0.3, dla którego wysokość barier U=0.27 eV, szerokość barier $d_{AlGaAs}=5$ nm oraz szerokość studni kwantowej $d_{GaAs}=3$ nm.

3.1 Zadania do wykonania

- 1. Korzystając w wcześniej opracowanej metody macierzy transferu oblicz współczynnik odbicia oraz transmisji przez rozpatrywany układ. Jaką charakterystyczną cechę transportu kwantowego można dostrzec na wykresie funkcji T(E)?
- 2. Oblicz charakterystykę prądowo-napięciową diody RTD korzystając z formuły Tsu-Esakiego

$$j = \frac{em^*k_BT}{2\pi^2\hbar^2} \int_0^\infty dE_z T(E_z) \ln\left[\frac{1 + e^{(\mu_s - E_z)/k_BT}}{1 + e^{(\mu_d - eV_{bias} - E_z)/k_BT}}\right],\tag{18}$$

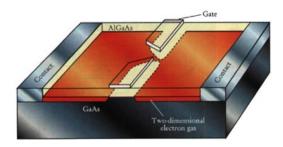
gdzie $\mu_{s,d}$ to potencjał chemiczny źródła i drenu, V_{bias} to przyłożone napięcie, zaś T to temperatura. Proszę założyć $\mu_s = \mu_d = 87$ meV. Proszę pamiętać, że przyłożenie napięcia do układu związane jest również z liniowym spadkiem potencjału w nanostrukturze, jak przedstawiono na rys. 4.



Rysunek 4: Liniowy spadek potencjału w wyniku przyłożenia napięcia V_{bias} do diody RTD.

4 Kwantowy kontakt punktowy w przybliżeniu adiabatycznym - kwantyzacja konduktancji.

Rozważmy kwantowy kontakt punktowy (QPC, z ang. quantum point contact) zdefiniowany w dwuwymiarowym gazie elektronowym 2DEG - patrz rys. 5.



Rysunek 5: Kwantowy kontakt punktowy oparty na 2DEG.

Potencjał jaki pojawia się w układzie po przyłożeniu do bramki napięcia V_q można opisać wzorem

$$V(x,y) = f[x-l,y-b] + f[x-l,t-y] + f[r-x,y-b] + f[r-x,t-y],$$
(19)

gdzie

$$f(u,v) = \frac{eV_g}{2\pi\varepsilon} \tan^{-1}\left(\frac{uv}{d\sqrt{d^2 + u^2 + v^2}}\right),\tag{20}$$

gdzie ε to przenikalność elektryczna materiału, l, r położenie lewego i prawego brzegu bramki zaś t, b to położenie graniczne bramki w kierunku pionowym, oraz d to odległość pomiędzy bramkami a 2DEG.

W ogólności układ ten jest układem dwuwymiarowym, dla którego równanie Schrödingera

$$-\frac{\hbar^2}{2m^*} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \psi(x, y) + V(x, y) \psi(x, y) = E\psi(x, y). \tag{21}$$

Przybliżenie adiabatyczne zakłada, że gdy zmiana potencjału w kierunku x jest dużo wolniejsza niż w kierunku poprzecznym y. Wtedy możemy założyć, że

$$\psi(x,y) = \sum_{n} \phi_n(x)\chi_n(y;x)$$
(22)

gdzie $\chi(y;x)$ oznacza, że χ jest funkcją zmiennej y ze stałym parametrem x.

Przy tym założeniu równanie Schrödingera możemy rozseparować na dwa równania (szczegóły przedstawiono na wykładzie)

$$-\frac{\hbar^2}{2m^*}\frac{\partial^2}{\partial y^2}\chi_n(y) + V(y;x)\chi_n(y;x) = E_n\chi_n(y;x)$$
 (23)

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m^*} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + E_n(x) \right] \phi_n(x) = E\phi_n(x)$$
 (24)

Badanie transportu elektronowego przez rozpatrywany układ polega na rozwiązaniu drugiego z równań dla potencjału $E_n(x)$ gdzie $n=1,2,3,\ldots$, uzyskanego z diagonalizacji pierwszego z nich dla określonych parametrów x.

W obliczeniach proszę założyć następujące wartości parametrów materiałowych: masa efektywna $m_{GaAs}^* = 0.063$, stała dielektryczna $\varepsilon = 13.6$ szerokość 2DEG W = 50 nm, długość 2DEG L = 100 nm, położenie bramek QPC w zakresie [0.3, 0.7]L z odległością między bramkami 0.6W, zaś d = 3 nm oraz $V_q = 4$ eV.

4.1 Zadania do wykonania

- 1. Narysuj efektywny potencjał z jakim oddziałuje elektron przepływający przez QPC, tzn. $E_n(x)$, dla $n = 1, 2, 3, \dots$
- 2. Korzystając z formuły Landauera oblicz konduktancje w funkcji padającego elektronu G(E), przy czym

$$G = \frac{2e^2}{h} \sum_{n} T_n(E) \tag{25}$$

3. Korzystając z formuły Landauera oblicz konduktancje w funkcji napięcia na bramce, dla dwóch wybranych wartości energii Fermiego, $E=50~{\rm meV}$ oraz $E=100~{\rm meV}$.